

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2003 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

04346487 **Image available**

METHOD FOR FORMING RESIST PATTERN

PUB. NO.: 05-338187 [JP 5338187 A]

PUBLISHED: December 21, 1993 (19931221)

INVENTOR(s): NISHIKAWA MASA HARU

APPLICANT(s): OLYMPUS OPTICAL CO LTD [000037] (A Japanese Company or Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.: 04-152469 [JP 92152469]

FILED: June 11, 1992 (19920611)

INTL CLASS: [5] B41J-002/16; C23F-001/00; H05K-003/06; H05K-003/14; H05K-003/18

JAPIO CLASS: 29.4 (PRECISION INSTRUMENTS -- Business Machines); 12.6 (METALS -- Surface Treatment); 42.1 (ELECTRONICS -- Electronic Components)

JAPIO KEYWORD: R002 (LASERS); R005 (PIEZOELECTRIC FERROELECTRIC SUBSTANCES); R044 (CHEMISTRY -- Photosensitive Resins); R060 (MACHINERY -- Automatic Design); R105 (INFORMATION PROCESSING -- Ink Jet Printers)

JOURNAL: Section: M, Section No. 1581, Vol. 18, No. 173, Pg. 157, March 24, 1994 (19940324)

ABSTRACT

PURPOSE: To easily form a resist pattern in an economical manner from an aspect of equipment or production cost using an inexpensive material without causing an environmental problem.

CONSTITUTION: In a resist pattern forming method for forming a resist film having a desired pattern on a base material 7 to be processed and adapted to post-processing generating a change in a part having no resist film on the basis of the difference between the properties of the surface due to the presence and absence of the resist film, an ink jet printer 6 drawing and printing an image on the basis of an image signal by the injection of ink is used and, as the ink of the ink jet printer 6, resist ink 5 is used. The image signal of a pattern to be formed is applied to the ink jet printer to print and form the pattern of the resist film due to the resist ink on the surface of the base material to be processed.

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平5-338187

(43) 公開日 平成5年(1993)12月21日

(51) Int. Cl. ⁶

識別記号

F I

B41J 2/16

C23F 1/00

H05K 3/06

3/14

102

8414-4K

E 6921-4E

A 7511-4E

9012-2C

B41J 3/04

103

H

審査請求 未請求 請求項の数1 (全20頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願平4-152469

(22) 出願日 平成4年(1992)6月11日

(71) 出願人 000000376

オリンパス光学工業株式会社

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号

(72) 発明者 西川 正治

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリ

ンパス光学工業株式会社内

(74) 代理人 弁理士 鈴江 武彦

(54) 【発明の名称】 レジストパターン形成方法

(57) 【要約】

【目的】 本発明の目的はレジストパターン形成が容易で、資材も安価で済み、環境問題の心配もなく、設備や生産コストの点でも経済的なレジストパターン形成方法を提供することにある。

【構成】 被加工基材7の表面に所望パターンのレジスト被膜を形成し、レジスト被膜の有無による表面の性質の差に基づいて、レジスト被膜の無い部分に変化を生ぜしめる後加工の工程に適用するための上記レジスト被膜のパターン形成方法において、画信号に基づいてインク噴射により像を描画印刷するインクジェットプリンタ6を用い、このインクジェットプリンタのインクとしてレジスト用インク5を使用すると共に、形成すべきパターンの画信号をこのインクジェットプリンタに与えて被加工基材面上にレジスト用インクによるレジスト被膜のパターンを印刷形成する。

